

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 1 月 12 日 (2017.1.12)

【公開番号】特開 2015-119164 (P2015-119164A)

【公開日】平成 27 年 6 月 25 日 (2015.6.25)

【年通号数】公開・登録公報 2015-041

【出願番号】特願 2014-163839 (P2014-163839)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 7 Z

H 0 1 L 21/304 6 4 8 G

H 0 1 L 21/304 6 4 3 A

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 11 月 17 日 (2016.11.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 1】

ここで、第 2 の実施形態に係る基板洗浄装置 1 4 A のように、アルカリ現像液の濃度を变化させる場合には、第 1 液供給部 4 0 B が備えるノズル 4 1 a から D I W を供給しながら、第 2 液供給部 4 0 C が備えるノズル 4 1 b からアルカリ現像液を供給すればよい。かかる場合、ウェハ W 上でアルカリ現像液と D I W とが混合され、ウェハ W 上で低濃度のアルカリ現像液が生成される。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 5】

ここで、図 1 0 に示すグラフの横軸は、ベアシリコンウェハ上の位置（ウェハ径）を示しており、直径 3 0 0 mm のベアシリコンウェハの中心位置を 0 とし、両端位置をそれぞれ - 1 5 0 , 1 5 0 としている。また、図 1 0 に示すグラフの縦軸は、トップコート膜の膜厚を示しており、その値は、トップコート膜を形成した後の膜厚に対する各膜厚の比率を示している。図 1 0 では、トップコート膜を形成する前の膜厚を実線 L 1 で、トップコート膜を形成した後の膜厚を破線 L 2 で、常温の純水を供給した後の膜厚を一点鎖線 L 3 でそれぞれ示している。ここで、常温の純水（以下、「C D I W」と記載する）とは、例えば 2 3 の純水のことをいう。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 13】

